



KINTEK SOLUTION

## Pacvd 目录

联系我们获取更多目录 样品制备, 热能设备, 实验室耗材和材料, 生化设备, 等等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



# 带液体气化器的滑动 Pecvd 管式炉 Pecvd 设备

货号: KT-PE12



## 简介

### KT-PE12 滑动 PECVD

系统：功率范围广、可编程温度控制、滑动系统快速加热/冷却、MFC 质量流量控制和真空泵。

[了解更多](#)

炉子型号	KT-PE12-60
最高温度	1200°C
恒定工作温度	1100°C
炉管材料	高纯度石英
炉管直径	60 毫米
加热区长度	1x450 毫米
炉腔材料	日本氧化铝纤维
加热元件	Cr2Al2Mo2 金属丝线圈
加热速率	0-20°C/min
热电偶	内置 K 型
温度控制器	数字 PID 控制器/触摸屏 PID 控制器
温度控制精确度	±1°C
滑动距离	600 毫米
射频等离子装置	
输出功率	5 -500W 可调, 稳定性为 ± 1%
射频频率	13.56 MHz ±0.005% 稳定度
反射功率	最大 350W
匹配	自动
噪音	
冷却	空气冷却
气体精确控制装置	
流量计	MFC 质量流量计
气体通道	4 个通道

流量 MFC1: 0-5SCCM O2  
 mfc2: 0-20scmch4  
 mfc3: 0- 100scm h2  
 mfc4: 0-500 scm n2

线性度	±0.5% F.S.
重复性	±0.2% F.S.
管路和阀门	不锈钢
最大工作压力	0.45 兆帕
流量计控制器	数字旋钮控制器/触摸屏控制器
标准真空装置 (可选)	
真空泵	旋片式真空泵
泵流量	4 升/秒
真空吸入口	KF25
真空规	皮拉尼/电阻硅真空计
额定真空压力	10Pa
高真空单元 (可选)	
真空泵	旋片泵+分子泵
泵流量	4L/S+110L/S
真空吸入口	KF25
真空规	复合真空计
额定真空压力	6x10-5Pa

以上规格和设置可定制

编号	说明	数量
1	熔炉	1
2	石英管	1
3	真空法兰	2
4	导管隔热块	2
5	导管隔热块挂钩	1
6	耐热手套	1
7	射频等离子源	1
8	精确气体控制	1
9	真空装置	1
10	操作手册	1

# 倾斜旋转式等离子体增强化学沉积 (Pecvd) 管式炉设备

货号: KT-PE16



## 简介

介绍我们的倾斜旋转式 PECVD 炉，用于精确的薄膜沉积。可享受自动匹配源、PID 可编程温度控制和高精度 MFC 质量流量计控制。内置安全功能让您高枕无忧。

[了解更多](#)

炉子型号	PE-1600-60
最高温度	1600°C
恒定工作温度	1550°C
炉管材料	高纯度 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 管
炉管直径	60 毫米
加热区长度	2x300 毫米
炉膛材料	日本氧化铝纤维
加热元件	二硅化钼
加热速率	0-10°C/min
热耦合	B 型
温度控制器	数字 PID 控制器/触摸屏 PID 控制器
温度控制精确度	±1°C
射频等离子装置	
输出功率	5 -500W 可调, 稳定性 ± 1%
射频频率	13.56 MHz ±0.005% 稳定度
反射功率	最大 350W
匹配	自动
噪音	
冷却	空气冷却
气体精确控制装置	
流量计	MFC 质量流量计
气体通道	4 个通道
流量	MFC1: 0-5SCCM O <sub>2</sub> mfc2: 0-20scmch <sub>4</sub> mfc3: 0- 100sccm h <sub>2</sub> mfc4: 0-500 sccm n <sub>2</sub>

线性度	±0.5% F.S.
重复性	±0.2% F.S.
管路和阀门	不锈钢
最大工作压力	0.45 兆帕
流量计控制器	数字旋钮控制器/触摸屏控制器
标准真空装置 (可选)	
真空泵	旋片式真空泵
泵流量	4 升/秒
真空吸入口	KF25
真空规	皮拉尼/电阻硅真空计
额定真空压力	10Pa
高真空单元 (可选)	
真空泵	旋片泵+分子泵
泵流量	4L/S+110L/S
真空吸入口	KF25
真空规	复合真空计
额定真空压力	6x10 <sup>-5</sup> Pa
以上规格和设置可定制	

编号	说明	数量
1	熔炉	1
2	石英管	1
3	真空法兰	2
4	导管隔热块	2
5	导管隔热块挂钩	1
6	耐热手套	1
7	射频等离子源	1
8	精确气体控制	1
9	真空装置	1
10	操作手册	1

# 等离子体增强蒸发沉积 Pecvd 涂层机

货号: KT-PED



## 简介

使用 PECVD 涂层设备升级您的涂层工艺。是 LED、功率半导体、MEMS 等领域的理想之选。在低温下沉积高质量的固体薄膜。

[了解更多](#)

样品支架	尺寸	1-6 英寸
	旋转速度	0-20rpm 可调
	加热温度	≤800°C
	控制精度	±0.5°C 岛电 PID 控制器
气体吹扫	流量计	质量流量计控制器 (MFC)
	通道数	4 个通道
	冷却方式	循环水冷却
真空室	真空室尺寸	Φ500mm X 550mm
	观察孔	带挡板的全视角观察孔
	腔体材料	316 不锈钢
	门类型	前开式门
	盖子材料	304 不锈钢
	真空泵接口	CF200 法兰
	气体入口	φ6 VCR 连接器
等离子电源	电源	直流电源或射频电源
	耦合模式	电感耦合或板电容
	输出功率	500W-1000W
	偏置功率	500v
真空泵	前级泵	15L/S 片式真空泵
	涡轮泵端口	cf150/cf200 620升/秒-1600升/秒
	溢流口	KF25
	泵速	叶片泵：15升/秒，涡轮泵：1200升/秒或1600升/秒
	真空度	≤5×10 <sup>-5</sup> Pa
	真空传感器	电离/电阻真空计/薄膜真空计

系统	电源	交流 220V /380 50Hz
	额定功率	5kW
	外形尺寸	900 毫米 X 820 毫米 X 870 毫米
	重量	200 千克





## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

